

カスタムPtfе耐腐食性6インチデュアルハンドルフォトマスククリーニングフラワーバスケットラック

商品番号: PL-CP05



前書き

高性能カスタムPTFE

6インチデュアルハンドルフォトマスククリーニングラックは、半導体および実験室のウェットプロセスに比類のない耐薬品性を提供します。これらの耐久性のあるフラワーバスケットは、過酷な酸や溶剤での安全なサンプルハンドリング、迅速な排水、汚染のないクリーニングを保証します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主な利点
半導体RCAクリーニング	シリコンウェーハをSC-1およびSC-2溶液に順次浸漬し、有機および金属汚染物質を除去します。	酸化剤および高温酸に対する完全な耐性により、キャリアの劣化を防ぎます。
フォトマスクエッチング	クロムまたはその他の遮光層を攻撃的なエッチャントを使用して除去する際に、6インチフォトマスクを保持します。	安全な位置決めによりマスクの振動を防ぎ、高忠実度のパターン転写と表面スクラッチゼロを保証します。
太陽電池テクスチャリング	光吸収を改善するために、KOHまたはHF/HNO3混合物を使用してシリコン表面にマイクロピラミッドを作成するプロセス。	耐久性のあるデュアルハンドル設計により、高容量の深層タンク産業環境での安全な取り扱いが可能です。
MEMSおよびマイクロ流体	マイクロ電気機械システム（MEMS）の製造に使用されるガラスまたはシリコン基板のクリーニングおよびエッチング。	材料の純度により、微細スケールデバイスの機能に干渉する可能性のある微量不純物の導入を防ぎます。
トレース分析ラボウェア	特殊な酸蒸気クリーニングまたは浸漬中に、ピーカー、蓋、または小部品を保持します。	金属イオンの保証された非存在（イオンフリー）は、超微量元素分析サポートのゴールドスタンダードです。
導電性ガラスの準備	OLEDまたはペロブスカイト太陽電池の研究用のITOまたはFTOコーティングガラス基板のクリーニング。	グリッド設計により、基板のエッジを保護しながら、導電層との完全な流体接触を可能にします。
ウェットケミカル現像	リソグラフィワークフローで、露光されたフォトレジストコーティングウェーハを現像液に輸送します。	さまざまな有機現像液にわたる化学的安定性により、一貫した結果と材料との相互作用ゼロが保証されます。

パラメータ	仕様詳細（モデル：PL-CP05）
主な材料	100%高純度バージンポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
基板互換性	標準6インチ（152.4 mm）フォトマスク、ウェーハ、またはガラス
ハンドル構成	バランスの取れた垂直リフティングのためのデュアルハンドル強化サポート
耐熱性	-200°C～+260°C（-328°F～+500°F）
化学的適合性	ユニバーサル（すべての酸、塩基、有機溶剤、およびピラニア溶液）

パラメータ	仕様詳細（モデル：PL-CP05）
スロット構成	カスタマイズ可能なスロット幅、ピッチ、および総容量（標準10/25スロット）
構造的特徴	CNC加工されたグリッドベースによる迅速な排水。丸みを帯びたサンプル接触点。
表面仕上げ	滑らかで非多孔性の機械加工PTFE表面（低摩擦）
ハンドル高さ	特定のクリーニングタンクの深さに合わせてカスタマイズ可能
金属含有量	ゼロ（金属フリー構造）